#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number 06279001 A

(43) Date of publication of application: 04 . 10 . 94

(51) Int. CI

C01B 3/32 B01J 23/80 C10K 3/04 H01M 8/06

(21) Application number. 05068193

(22) Date of filing. 26 , 03 , 93

. (71) Applicant:

IDEMITSU KOSAN COLTD

(72) Inventor:

MATSUMOTO HIROTO IIDA HIROSHI

(57) Abstract

PURPOSE: To provide a process for the production of a hydrogen-containing gas in high efficiency at a low cost while keeping high methanol conversion and suppressing the production of CO and suitable for the production of a fuel for solid polymer fuel cell, phosphate-type fuel cell, etc

CONSTITUTION: A hydrogen-containing gas is produced

(54) PRODUCTION OF HYDROGEN-CONTAINING GAS by mixing methanol with oxygen and water to obtain a mixture containing 0.01-0.5 mol of oxygen based on 1 mol of methanol, introducing the mixture into a catalyst layer heated at  $\approx 100$  °C to effect the reaction of the components and adjusting the outlet temperature of the catalyst layer to 5200°C when the above reaction teaches a stationary state.

COPYRIGHT: (C)1994.JPO

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-279001

(43)公開日 平成6年(1994)10月4日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup> C 0 1 B 3/32  B 0 1 J 23/80  C 1 0 K 3/04  H 0 1 M 8/06	識別記号 片内整理番号 A 7106-4H R	F I 審查請求	技術表示簡所 末請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)
(21)出顧番号	特願平5-68193	(71)出願人	000183646 出光興産株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
(22)出願日	平成5年(1993)3月26日	(72)発明者	. And I
		(72)発明者	・ 飯田 博 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地 出光興産株 式会社内
		(74)代理人	. was in the

## (54)【発明の名称】 水素含有ガスの製造方法

(57)【要約】 【目的】 この発明は、固体高分子燃料電池、リン酸型 燃料電池等の燃料製造に好適であり、高いメタノール転 化率を維持しつつCOの生成を低く抑えることができ、 経済的にかつ効率よく水素含有ガスを製造することがで きる水素含有ガスの製造方法を提供することを目的とす

【構成】 前記目的を達成するための請求項1に記載の る。 発明は、メタノール1モルに対し酸素が0.01~0. 5モルの割合になるようにメタノールと酸素と水とを共 存させた後、これを予め100℃以上に加熱した触媒層 に導入して反応させ、前記反応が定常状態になった後に 前記触媒層の出口温度を200℃以下にすることを特徴 とする水素含有ガスの製造方法である。



【特許請問の範囲】

【請求項1】 あらかじめ100 C以上に加熱された触 媒質に テクノーエとメクノール1 それに対して0.0 1 > 0 っセルの帳本と水とを導入して反応を行い、前 記反応が正常状態になった後に前記触媒層における出口 部の温度を200 C以下に調整することを特徴とする水 素含有ヴィの製造 5法。

【請求項2】 触媒層に導入する酸素がメタテー・1 モルに対しり、25~0 5モルの割合である前記請求項1に記載の水素含有ガノの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、水素含有ガスの製造方法に関し、更に詳しては、固体高分子燃料電池、リン酸型燃料電池等の燃料製造等に好適であり、高いメタノール転化率を維持し、つCOの生成を低し抑えることができ、経済的にかつ効率よっ水素含有ガスを製造することができる水素含有ガスの製造方法に関する。

### [0002]

【従来の技術と発明が解決しようとする課題】従来より、メタノールと水とを原料として水素含有ガスを製造する方法が知られている。この方法は、燃料電池の燃料製造、オンサイト水素製造等のプロセスに用いられている。前記燃料電池の燃料製造等のプロセスにおいては、そのプロセスにおける阻害物質の生成をできる限り抑えると共に効率を高く維持することが要求される。

【0003】前記燃料電池の燃料製造等のプロセスにおいては、COがそのプロセスにおける反応の阻害物質になることが知られている。ところが、かかる水素含有ガスの製造方法によるとCOが生成するので、この方法を30前記燃料電池の燃料製造等に用いる場合には、COの生成をTきご限り低三折さることが必要とされる。具体的には、例えばリン酸型燃料電池の燃料製造においてはCOの生成を1%以下に抑えることが必要とされ、固体高分子燃料電池の燃料製造においてはCOの生成を数十ppm以下に抑えることが必要とされる。

【0004】ところで、従来における、かかる水素含有ガスの製造方法として、メタノールと水とを原料とし、 網系触媒を用いて水素含有ガスを製造する方法が知られている。この方法の反応は、以下の式(1)で表わされ、その素反応は式(2)及で式(3)で表わされる。

#### [0005]

CH<sub>2</sub> OH · H<sub>3</sub> O · CO<sub>5</sub> · 2H · · · (1)

 $CH_{0}OH_{0}CO + 2H_{0} + \cdots + CO$ 

 $CO \cdot H_{c}O \cdot CO \rightarrow 2H \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$ 

上記反応において、式(2)の反応は吸熱反応であるので、メタノールの転化率を同土させるためには反応温度 を高くする必要がある。一方、式(3)の反応は発熱反 心であるので、高温条件下では反応が進行しないでCO が多く残存してしまうことになる。したがって、この反 50 応においてCO濃度を低下させるためには、ホーメタイール比を増大させるか。あるいは低温条件下で反応を行
なっことがご要になる。

【0006】しかしながら。前記水、メタノール比を増 大させる方法では、京料であるまを気化させなければな らないので、そのためのコスト及びエネルギーが増大し 経済的でないという問題がある。

【0007】そこで、前記低起条件ででも高い活性を有 する触媒を用いることにより、低い反応温度で水素含有 10 ガスを製造する方法が検討されている。例えば、特開平 1 139001号公報においては、低温高活性な鋼、 亜鉛、プロム、鉄等を触媒として用い、水とメタノール との比(水「メタノール)が1、2である原料を230 でで反応させると、メタノール転化率を98、3%と高 く維持すると共に、CO濃度が1、3%と低で抑えることができる質が示されている。

【0008】しかし、現在のところ、前記公報に記載された前記結果が限界であり、これ以上COが生成する濃度を低う抑えることはできないのが実情である。したがって、低温高活性な触媒を用いる前記公報に記載された方法においても、高いメタノール転化率を維持しつった幅なCO濃度の低減を期待することができないという問題がある。

【0009】一方、メタノール水蒸気改質時に酸素を共存させ、銅系あるいは貴金属系触媒の存在上で反応させて水素含有ガスを製造する方法が、例えば特別昭61127601分公報、特開平2 116603号公報等に関示されている。しかし、これらの公報には、CO優度の低減に関する、又は、高いメタノール転化率に関する記載はなく、これらの方法では、高いメタノール転化率を維持しつつCOの生成を低く抑えることはできないという問題がある。

【0010】この発明は、前記問題を解決すると共に、 固体高分子燃料電池、リン酸型燃料電池等の燃料製造に 好適であり、高いメタノール転化率を維持しつつCOの 生成を低く抑えることができ、経済的にかつ効率よ「水 素含有ガスを製造することができる水素含有ガスの製造 り法を提供することを目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するための前記請求項1に記載の発明は、あらかじめ100 C以上に加熱された触媒層に、メタノールとメタノール1モルに対して0.01~0.5円の酸本と水とを導入して反応を行い、前記反応が定営制度になった後に前記触媒層における出口部の温度を200 C以下に調整することを特徴とする水素含有ガスの製造方法であり、請求項2に記載の発明は、触媒層に導入する酸素がメタノール1円ルに対し0.25~0.5モルの割合である前記請求項1に記載の水素含有ガスの製造方法である。

【0012】以下、この発明に係る水素含有ガスの製造

7独につき詳細に説明する。

【0013】この発明においては、先ず、メタノール1 モルに対し酸素が所定の割合になるように、メタノール 上酸素と水と全含有する京砂を調査する。

【0011】前記メダノールおよびかとしては、おれぞれ純品を用いても良い、また、メダーールが辞改りして用いても良い。酸素は、純酸素ガノを用いても良い、また産素、アルゴになりの不活性ガスト酸素とを設定して得られる酸素含有ガス、あるいは空気を用いても良い。

【0015】酸素のメタノールに対する割合としては、 通常、メタノール1モルに対し酸素が0.01~0.5 モルであり、好ましてはメタノール1モルに対し酸素が 0.25~0.5モルである。前記メタノール1モルに 対し酸素の割合が前記範囲内にあると、COの生成を低 く抑えることができ、水素発生量の低下を抑えることが できる。

【0.0.1.6】また、水の割合は、通常メタノール1モルに対し1、0.2.5モルであり、好ましてはメタノール1モルに対し1、2.2.0モルである。水の割合が前記範囲内にあると、COの生成を少なさせることがで 20きる。なお、水の割合が、メタノーな1モルに対し、1、0モル未満であるとCOの除去が充分でないことがあり、一方、2.5モルを越えると水の気化のために使用されるエネルギーが増入し、経済的でなど、幼科が低下することがある。

【0017】メタノール、酸素および水を触媒層に供給 する方法としては、触媒層においてこれら、者が共存す る状態になる限りいかなる供給方法であっても良く、た とえば、メダイールおよび水を、共に又は別々に適宜の 方法により加熱して気化させた蒸気に酸素を供給して得。30 られる原料ガスを触媒層に供給する方法を挙げることが、 できる。具体的には、例えば、メタニールおよび水をそ れぞれ別の蒸発器を用いてガス化させた後、これに空気 を混合することにより原料ガスを得、この原料ガスを触 媒層に供給する方法、メタノール水溶液を蒸発器を用い てガス化させ、メダノールと水とを含有する混合ガスを 調製し、この混合ガスに酸素含有ガスを混合させること により原料ガスを調製してこれを触媒層に供給する方法 を挙げることができる。この外に、触媒層に、メタノー ルの気化物、水蒸気、酸素ガスもし「は酸素含有ガスを一40」 別々に触媒層に供給する方法、メダノール水溶液を気化 させた差気と酸素または酸素含有ガノとを触媒層に供給 する方法を挙げることもできる。

【0018】この発明においては、次に、前記メタニール、酸素および水を、予め100℃以上に加熱した射媒層に導入し、これらを反応させ、前記反応が定常状態になった後に前記触媒層における出口部の温度を200℃以下にすることにより水素含有ガスを製造する。

【0019】前記触媒層としては、例えば、適宜に選択 したそれ自体公知の改質器等の反応器に充填された触媒 50 層 ハニカムに担持された触媒層、又は反応管内部の管 壁に担持された触媒層等を挙げることができる。

【0020】前記触媒網を構成する触媒としては、一般にメタイトや水蒸気改賞反応に使用することができる無媒であれば特に制限はなく、例えば、網含有触媒、VIII株金属担接触媒等を挙げることができる。

【0021】前記総合有触媒としては、例えばCuOMeO. (ただし、式中、MeO.は全域酸化物を表わし、MeはMn. Si等の全域を表わす。) て表わされる酸化銅混練触媒。Cuイナン交換MeO. (ただし、式中、MeO. はSiO。、ZnO。、Al。O。等の金属酸化物を表わす。) で表わされる銅イナン交換触媒、Cu Al。O。、Cu、SiO。等の酸化銅担持触媒、CuO・ZnO、CuO・XiO。CuO・CiO、CuO・NiO、ZnO等の創含有共化触媒を挙げることができる。

【0022】前記VIII 族金属担持触媒としては、例えばCo、Ni、Pt、Pd等の金属と、SiO<sub>2</sub>、ZrO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>等の金属酸化物とを有する触媒を挙げることができる。

【0023】これらの中でも好ましいのは銅含有触媒であり、特に好ましいのは銅含有単化触媒である。これらは、低温での活性が高く、かっアルデヒド、ギ酸等の副生を少なくすることができる点で好ましい。

【0021】前記銅含有触媒としては、例えば、銅ニニッケル。亜鉛の組合せからなる銅含有触媒を、前記銅含 有共化触媒としては、例えば、銅ニコバルト。亜鉛の組合せ又は銅ニニッケル。ランタンの組合せからなる銅含 有共化触媒を挙げることができる。

【0025】前記網・ニッケル・亜鉛の組合せからなる 鋼含有触媒としては、例えば、鋼が5~30重量%、ニッケルが5~50重量やおよび亜鉛が30~90重量% それぞれ含まれる合金を展開することにより、触媒として下活性な亜鉛をアルカリで溶出してなる鋼含有触媒を 挙げることができる。前記亜鉛の溶出量は、通常、前記 合金中の亜鉛の含有量の10~90重量%である。前記 展開は、通常20~100℃の温度下に、前記合金を、 例えばカ性ソーダ水溶液、カ性カリ水溶液、欠酸カリウス水溶液等のアルカリ溶液で処理する通常の展開法に従 一て行なうことができる。

【0026】前記展開により得られる展開合金中の、 銅、ニッケルおよび亜紅の含有割合は、銅が10~50 重量%、ニッケルが20~80重量%および亜鉛が10 ~60重量%である。前記郷、ニッケルおよび亜鉛の含 有量が前記範囲内にあると一活性を長く維持することが できると共に、副生物の生成を低く抑えることができる ので好ましい。

【0027】この銅含有触媒は、前記展開合金を、例えば分離し、水洗し、乾燥し、成形し、還元することにより調製することができる。

【0028】前記分離は「例えばる遷、遠心分離」デカンテーション等の通常の固被分離方法により行なうことのできる。前記水洗は、前記アルカリ存被の終去を目的とし、例えば蒸資水又はイナン交換水を用いた傾斜法により行なうことができる。前記乾燥は、3~12時間風乾することにより行なうことができる。前記乗開合金に滑剤としてダップァナーを加えた後、錠剤状、ベレット状、粒状、細片状、板状等の種々の無状に行なることができる。前記環元は、通常、200~500℃の生素が必要用気下で行なうことができ、また、ニリウムカス、ネナンガス、アルゴンガス、窒素ガス等の不活性カアを用いて希釈して行なうことができる。

【0029】前記銅 フバルト 亜鉛の組合せからなる 鋼含有共化触媒としては、例えば、それぞれの元素の割合、即も原子比がCu \* Cu \* Zn \* 1 \* 0 \* 0 ! ~ 5 0 \* 0 \* 1 ~ 1 \* 0 0 0 、好ましてはCu \* Co \* Zn \* 1 \* 1 ~ 1 0 \* 1 ~ 2 0 である鋼含有共沈触媒を挙げることができる。前記原子比が前記範囲内にあると、所 望の性能を有する鋼含有共化触媒を得ることができるの 20 で好ましい。

【0031】銅含有共化触媒に含まれる前記各元素は、通常、水溶性の塩から得ることができる。そのような塩レーでは、例えば硝酸塩、酢酸塩、硫酸塩、シュウ酸塩、ギ酸塩等を挙げることができる。更に具体的には、硝酸銅、酢酸銅、硫酸銅、シュウ酸銅、ギ酸銅、硝酸コパルト、酢酸コパルト、硫酸コパルト、シュウ酸コパルト、ギ酸コパルト、硝酸亜鉛、酢酸亜鉛、硫酸亜鉛、シュウ酸亜鉛、ギ酸亜鉛、硝酸二ラケル、酢酸二ラケル、硫酸ニラケル、主酸ニラケル、硫酸ニラケル、主酸ニラケル、硫酸ランタン、シュウ酸ランタン、ショウ酸ランタン、米酸ランタン等を挙げることができる。

【0032】これらの飼含有共沈触媒の調製について、 以下に説明する。

【0033】まず、銅の水溶性塩とコパルトの水溶性塩と亜鉛の水溶性塩との混液、又は銅の水溶性塩とニッケルの水溶性塩とランタンの水溶性塩との混液および注酸剤(炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、カ性ソーダ、カ性カリ等)の水溶液と混合して池瀬を析出させる。

【0034】前記混殺の水務性塩の濃度としては、通常 0.1~10モル しであり、好ましくは0.5~5モル しである。また、前記沈澱剤としては、特に制限は 50 ないが原酸サリリウムが好ましい。そして、前記水溶液の沈纖剤の濃度としては、0.05~5モル・Lが好ましい。重記提校と沈微剤水溶液との液量は(容量は)としては、0.1~10が好ましい。前記提校と沈微剤水溶液とを混合する際の両流の温度としては、通常50~90℃であり。好まし、は60~85℃である。前記提校と沈微剤水溶液との混合は、迅速に行うのが好ましい。

【0035】混合後、混合液を熟成させる。共化生成直後の新しい沈酸はほ産と接触させておこと、沈酸粒子は更に成長して大きしなり、沈酸の尖った部分やエッジ等が消えて平滑になることが知られており、熟成により均一な粒子の沈酸が得られるようになる。また、熟成時に、溶液のpHが変化することから、結晶構造や化学組成が変化していると考えられ、再現性のよい触媒を得るためにも熟成操作が必要である。前記熟成条件としては、温度が50~90℃、熟成時間が1~10時間、pHが8~11が好ましい。

【0036】以上のようにして得られた共沈物を水洗した後、乾燥し、充分に焼成することにより、銅含有共沈触媒を得ることができる。前記乾燥の温度としては、通常100~120℃であり、前記乾燥の時間としては、通常5~20時間である。また、前記焼成の時間としては、通常300~600℃であり、前記焼成の時間としては、通常1~10時間である。

【0037】前記触媒層の長さおよび断面積は、リアクターの伝熱、原料の供給速度、反応圧力等の条件により適宜に選択することができる。

【0038】この発明においては、前記メタノール、酸素および水を前記触媒層に導入する前に、前記触媒層を予め100℃以上に加熱しておく。前記触媒層を予め100℃以上に加熱するには、例えば、触媒層たる改質器又は反応管を、設定した温度に自動的に加熱することができる自動制御機能付きの電気炉等の加熱装置の内部に配置し、前記加熱装置から前記触媒層に熱を供給する方法を採用することができる。なお、前記加熱はN。ガス雰囲気下で行なうのが好ましい。前記触媒層の温度は、例えば前記触媒層に熱電対の保護管を挿入し、前記保護管に熱電対を挿入することにより測定することができ40 る。

【0039】この発明においては、前記触媒層を100 C以上に加熱した後に、前記触媒層に水素違立等の処理 を適宜に行なうことができる。

【0010】前記触媒層への前記原料ガスの導入は、例えば圧逐、プロアー等により行なうことができる。

【0.0.4.1】前記触媒層において前記原料ガスを反応させる際の圧力としては、通常、常圧 $\sim 3.0\,\mathrm{Kg}$   $\,\mathrm{cm}^2$  Gであり、好ましくは常圧 $\sim 1.0\,\mathrm{Kg}$   $\,\mathrm{cm}^2$  Gである。前記圧力が前記範囲内にあると、メタノーのの転化率を高く維持することができるので好ましい。また、原

料の供給速度(ガス空間速度)としては、通常100~ 100、000(h ) であり、好ましゃに1、000~ ~10、000(h ) である。

【0042】この原明においては、前記触場層における 前記原料ガスの反応が定常状態になった後に、前記触媒 層における出口部の温度を200℃以下にする。前記定 常状態とは、触媒層における温度分布の変化が安定した 状態をいう。前記触媒層における出口部の温度を200 で以下にするには、例立ば、前記触媒層を内部に収容す も加熱装置の熱供給量を低下させる方法又はその熱供給 10 を停止する方法、冷却水等を用いる方法等を適宜に選択\*

CH<sub>2</sub>OH  $\cdot$  3  $\cdot$  2O  $\rightarrow$  CO<sub>2</sub>  $\cdot$  2H<sub>2</sub>O  $\cdot$   $\cdot$  (4)

前記式(4)の反応は大きな発熱反応であるので、この 反応により前記触媒層における人口部の温度が上昇す る。この発熱反応により生じた熱により、前記式(2) で表わされる吸熱反応が促進され、触媒層に導入した。 タノールがほぼ完全に転化する。

【0046】このとき、触媒層の加熱温度が100℃ た 満であると、前記式(4)で表わされる反応が充分に進 行せず、この反応により生しる熱を前記式(2)で表わ。20 される吸熱反応に充分に供給することができないので、 前記式(2)で表わされる文応を促進させることができ ず、メタノールの転化率を高くすることができない。ま た、酸素の割合がメタノール1モルに対しり、01モル 未満であると、前記式(1)で表わされる発熱反応が充 分に起こらないので、前記式(4)で表わされる発熱反 応により生じる熱を前記式(2)で表わされる吸熱反応 に充分に供給することができず、メダバールの水壊への 転化が充分でないことがある。一方、ロ. 5モルを越え ると、前記式(4)で表わされる発熱反応にメタノール。30 **を多量に消費してしまい、前記式(2)で表わされる吸** 熱反応から生成する水素の量が大きく減少し、水素の生 成効率が低下することがあるので好ましてない。

【0047】その後、前記式(4)で表わされる反応による発熱と、前記式(2)で表わされる反応による吸熱とが平衡し、触媒層の温度分布が安定し、触媒層は定常状態になる。

【0048】続いて、適宜にの方法により200で以下にその温度が維持された触媒層の出口付近(以下、触媒層における出口部と称する。)において、主に前記式(3)で表わされる反応が進行し、水素含有ガスが生成する。

【0049】このとき、触媒層における出口部の温度等200℃よりも大きいと、発熱反応である前記(3)で表わされる反応が進行しにことなり、副生物たるCOをCO。に転化することができず、COの量を低減することができないことがある。なお、触媒層における出口にの温度の下限は、前記式(2)で表わされる吸熱反応が進行しうる温度の下限と一致する。

【0050】これ発明における、経済的に水素含有ガス=50=った。この触媒を以下の実施例および比較例において使

\* することができる。これらの中でも、加熱装置の熱供給量を低下させる方法およびその熱供給を停止する方法 が、冷却装置などを設けら必要すないので好ましい。

【0043】次に この発明における、水素含有ガスが 生成する反応の機構について説明する。

【0041】 光寸、子め100 C以上に加熱した触媒質に、原料たるメタノール、酸素および水を含有する原料ガスを薄入すると、触媒流の人口付近(以下、触媒層における人口部と称する。)の触媒上で、メタノールと酸素とが以下に示される式(4)のように反応する

#### [0045]

を製造することができる態様としては、触媒層における 出口部の温度を200 C以下にする際に、加熱装置から の熱供給を停止して電力消費を抑えつつ、水素含有ガス の生成反応を進行させる態様である。

【0051】この場合、外部から触媒層に熱が供給されない上に前記式(2)で表わされる吸熱反応により触媒層の熱が消費されるので、そのまま熱が消費され続けて触媒層の温度が低于すると、吸熱反応である前記式

(2) で表わされる反応は進行しならなり、メタノールの転化率が低下し、水素含有ガスの生成量が低下する。しかし、外部からの熱供給を停止しても、前記式(4)で表わされる発熱反応により生しる熱量(a)が前記式(2)の吸熱反応で消費される熱量(b)よりも大きい状態(a)も)に維持することができれば、前記式

(2) で表わされる反応の進行を阻害せず、メタノールの転化率を低下させることなっ水素含有ガスを製造することができる。 a P b とするための、原料ガスにおける酸素の割合はメタノール1モルに対しり、25~0.5 モルである。

【0052】以上のように、この発明によると、高いメタノール転化率を維持しつつじ〇の生成を低く抑えることができ、また外部から供給する熱量を少なくすることができるので、経済的にかつ効率より水素含有ガスを製造することができる。

#### [0053]

【実施例】以下に、この発明の実施例について説明する。なお、この発明は、以下の実施例に何ら限定される40 ものではない。

【0054】 (触媒の調製) 硝酸銅 (3水塩) と硝酸亜 鉛 (6水塩) と硝酸アルミニウム (9水塩) とを含む水 溶液に、次酸サトリウム水溶液を添加し、沈澱物を生成 させた。その後、この沈澱物を濾過し水洗した。得られた沈澱物を120℃の温度下で約12時間乾燥させた 後、450℃で2時間焼成して、銅 亜鉛 アルミニウムの組合せからなる銅合有共池触媒を調製した。

【0055】この銅合有共志触媒における各元素の比は、Cu: Zn: Al 1:2:0.5 (モル比)であった。この触媒をロモの実施をおとり比較毎において値

3

用した。

【0056】(実施例1)16~32メッシュに成型し た前記調合有共**沈触媒 5 c c** と不活性なシリコンカーバ イト(SiC)10ccとを混合して石英ガラス製の反 応管に充填して触媒層を形成した。このときの触媒層の 長さは約8cmであった。そして、この石英ガラソ製の 反応管を一所定の温度に自動制御可能な電気炉内に配置 1 75

【0057】前記触媒層を使用する前に300Cで2時 間水素還元を行なった後、N。ガス中で、反応管を加熱。 するために設定した炉内部の温度(以下、炉加熱温度と 称する。)を220℃に保持した。

【0058】次に、前記石英ガラス製の反応管内に形成 した触媒層の中心部に熱電対の保護管を挿入し、前記保 護管内に熱電対を挿入すると共にこれを上下させること により、前記触媒層内における、触媒層の人にから1c m(触媒層における人口部)、4cm、7cm(触媒層 における出口部)の各点における温度を測定した。前記 3点における温度の平均値を平均触媒温度とした。

【0059】そして、メタノールと酸素と水とからな り、メタノール1千ルに対し水が1.6モルであり、メ タノール1モルに対し酸素が0.3モルである原料ガス を、メタノールの供給速度(LHSV)が 1.3 h 、 反応圧力が常圧である条件にて、前記触媒層に導入し反 応させた。そして、触媒層における温度分布が安定する まで約5分間、前記炉加熱温度を220℃に保持した。

【0060】その後、炉如熱温度を200℃に下け、1 時間経過後、反応中の触媒層における温度分布を測定し た後、生成ガスの分析を行なった。その結果を表1に示 した。結果としては、70.0%という高い割合で水素 30 ガスを含有する水素含有ガスを得ると共に、100%と い、高いメダバール転化率を維持しつつ、敵きガス中の CO濃度をロ. 5%という低い値に抑えることができ 7-0

【0061】(実施例2)炉加熱温度を220℃から2 00℃に下げたのを、220℃から150℃に下げた外 は実施例1と同様にして水素含有ガスの製造した。その 結果を表工に示した。結果としては、70、0%という。 高い割合で水素ガスを含有する水素含有ガスを得ると共 に、99.5%という高いメタノール転化率を維持しつ。40。 つ、乾きガス中のCO濃度をO. 1%という低い値に抑 えることかてきた。

【0052】 (実施例3) 炉加熱温度を220℃から2 QQCに同けたのを、22Qでから12Qでに下げた外 は実施り1と同様にして水素含有ガスの製造した。その 結果を表1に示した。結果としては、69.8%という。 高い割合に水素ガスを含有する水素含有ガスを得ると共 に、99、1%という高いメタノール転化率を維持しつ。 つ、乾きガソ中のCO濃度を0.4%という低い値に抑 えることができた。

【0063】 (実施例4) が加熱温度を220℃から2 00(に下げたのを 220℃から100℃に下げた外 は実施例1と同様にして水素含有ガスの製造した。その。 結果を表1に示した。結果としては、69、9%という 高い書合で水素ガスを含有する水素含有ガスを得ると共 に、92、5%という高いメダイール転化率を維持しつ つ、乾きガス中でCO濃度を0、3つといっ低い値に排 えることができた。

10

【0064】 (天晦何5) が加熱温度を220℃から2 - 0.0 €に下げたり至、外部から熱供給するのを停止し、 220℃から自然に温度が低 じせるようにした外は 実施 例1と同様にして水素含有ガスの製造した。その結果を 表1に示した。結果としては、69.9%という高い割 合で水素ガスを含有する水素含有ガスを得ると共に、8 2. 6%という高いメタノール転化率を維持しつつ、乾 きガス中のCO濃度を0.3%という低い値に抑えるこ 上ができた。

【0065】(比較例1) が加熱温度を220℃から2 00℃に下げたのを、220℃に維持した外は実施例1 と同様にして水素含有ガスの製造した。その結果を表1 に示した。結果としては、69、5%という低い割合で 水素ガスを含有する水素含有ガスしか得ることができ ず、また、メタノーが転化率は100%と高かったもの の、乾きガス中のCO濃度も1.0%といる高い値にな

【0066】実施例1乃至5および比較例1の結果よ り、炉加熱温度を低下させず、触媒層における出口部の 温度を200℃以下にしない場合には、水素ガスの生成 効率が悪く、副生物たるCOの生成を低く抑えることが できないことがわかる。

【0067】(実施例6)原料ガスを導入するときの炉 加熱温度である220℃を110℃に代えた外は実施例 1 と同様にして水素含有ガスの製造した。結果として は、反応前の平均触媒温度は108℃であったが、反応 が開始すると3~4分後に触媒層における人口部の温度 は約300℃に達した。その後、反応は定常状態とな り、水素含有ガスを効率よく製造することができた。

【0068】 (比較例2) が加熱温度を110℃から9 5℃に代えた外は実施例6と同様にして水素含有ガスの 製造した、結果としては、原料カスを導入しても触媒層 の温度の主昇および大素含有ガスの生成は認められなか。 - 12

【0069】実庭例らおよび比較例じの結果より、原料 ガスを触媒層に導入する前に炉加熱温度を予め100℃ 辺上に加熱しない場合には、触媒層に原料ガスを導入し ても、水素含有ガスの生成反応が開始しないことがわか。

【0070】この発明における条件で反応を行なうと、 メタノール転化率を高い値を維持してい、CO濃度を低 人抑えて、経済的にかつ効率より、水素ガスの濃度の高



# い水素含有ガスを生成することができる。

11

### \* 【表1】

素含有	ガスを生成する	ることができ	ಕಳು.	*		·	実施例 5	比較例:
071	1		実施例二	実施例2	実施例3	実施例4	美胞切り	
			700	200	226	220	220	220
原料導入開始時0° 反応管加熱温度 ℃)		220	220		100	外部が熱なし	220	
反応中の 反応管加熱温度(*C)		200	150	120	294	280	373	
触媒層入口温 反 底 触媒層出口温		352	316	298	98	65	232	
			198	148	118	165	135	298
	平均触媒層温度(℃)		265	205			5 82.6	100
メタノール転化率(			100	99.			9 69.9	
生成ガス 組成 <sup>11</sup> (vol%)	H <sub>2</sub> 中成ガス CO		70.		-		3 0.3	1.0
		CO	0.5				8 29.8	
	組成1	CO2	29.	$\begin{array}{c c} 5 & 29. \\ \hline  & 0 \end{array}$	0	0	0	0
	その他21	0				to at		

1) WENAVIRUX 2) 気相および液相ともにアルデヒド、羊酸、エーテル等の属性は認められなかった。

【発明の効果】この発明によると、固体高分子燃料電 池、リン酸型燃料電池等の燃料製造に好適であり、高い メタノール転化率を維持しつつCOの生成を低く抑える※

※ことができ、また、外部から供給する熱量を少なくする ことができるので、経済的にかつ効率よく水素含有ガス を製造することができる水素含有ガスの製造方法を提供 することができる。